

N掺杂对 TiO₂形态结构及光催化活性的影响

刘守新* 陈孝云 李晓辉

(东北林业大学材料科学与工程学院, 哈尔滨 150040)

摘要: 以 $TiCl_4$ 为钛源, 采用酸催化水解法合成 TiO_2 前驱体, 在 NH_3/N_2 气氛下经不同温度处理制得浅黄色的 N掺杂 TiO_2 (TON) 光催化剂。以苯酚为模型物, 考察了催化剂在紫外光区、可见光区及太阳下催化活性; 采用 DRS、XPS、XRD、FTIR、SEM 及低温氮物理吸附对光催化剂的晶相结构、光谱特征和表面结构等进行表征。系统研究了 N掺杂对 TiO_2 形态结构及光催化活性的影响。结果表明, 掺杂 N 以阴离子形式进入 TiO_2 体相中置换晶格中的 O, 适宜温度下制得适量 N掺杂的 TON 在紫外光区、可见光区及太阳光下均表现出较高的活性。N掺杂在 TiO_2 表面生成 Ti-O-N 键, 形成新的能级结构, 使催化剂的吸收红移至 450~550 nm, 诱发 TiO_2 可见光催化活性。同时高温下煅烧, N掺杂可抑制 TiO_2 晶粒生长, 减缓 TiO_2 粒子间团聚, 提高锐钛矿相向金红石相转变温度, 减缓相转化速度。

关键词: TiO_2 ; 氮掺杂; 热处理; 可见光; 光催化剂

中图分类号: O643 文献标识码: A 文章编号: 1001-4861(2008)02-0253-07

Effect of N-doping on Structure Characteristics and Photocatalytic Activity of TiO_2 Photocatalyst

LIU Shou-Xin* CHEN Xiao-Yun LI Xiao-Hui²

(College of Material Science and Engineering, Northeast Forestry University, Harbin 150040)

Abstract: The nitrogen doped TiO_2 photocatalyst(TON) with visible-light response were prepared by acid catalyzed hydrolysis followed by calcination in NH_3/N_2 atmosphere. The photocatalytic activity of the TON and TiO_2 were investigated through degradation of phenol under artificial ultraviolet light, visible light and solar light irradiation, respectively. DRS, XPS, XRD, FTIR, SEM and N_2 adsorption isotherm were used for catalyst characterization. The results show that anion N are incorporated into TiO_2 lattice and substitute for parts of O. TON with suitable N-doping and calcination temperature exhibited high activity under ultraviolet light, artificial visible light and solar light irradiation. Doped-N could form a new bond enrgy level above the valence band of TiO_2 which can extend the adsorption edge to 450~550 nm. In addition, doped-N could be beneficial for TiO_2 dispersion, increase S_{BET} and retard phase transformation.

Key words: TiO_2 ; nitrogen doping; heat treatment; visible light; photocatalyst

环境污染控制与治理是 21 世纪面临和亟待解决的重大问题。近年来利用光催化氧化技术解决日益严重的水、空气、土壤等环境污染问题的研究发展非常迅速^[1-5]。但从应用角度看, 目前还存在问题: 光

催化剂光谱响应范围<387 nm, 对太阳能利用率低^[6-8]; 以电驱动的紫外光源其电光转换效率低于 25%, 而大部分电能转化为热能转移出反应体系未被利用, 反应系统总能量利用率低^[9]; 常规二氧化钛

收稿日期: 2007-10-10。收修改稿日期: 2007-11-27。

国家自然科学基金(No.30400339)资助项目, 教育部新世纪优秀人才资助计划(No.NCET-05-0327), 教育部博士点基金(No.20050225006)。

*通讯联系人。E-mail: liushouxin@126.com; Tel: 0451-82191204

第一作者: 刘守新, 男, 37岁, 教授, 研究方向: 光催化, 炭材料。

光催化剂的量子效率低等^[10]。因此,研制太阳光响应光催化剂拓展其光谱响应范围(>387 nm),提高光催化量子效率成为研究热点^[11~13]。

研究表明^[7,8,13],N掺杂可以有效提高 TiO₂ 对可见光响应能力。Asahi 等^[13]利用 TiO₂ 与 N₂ 反应制备了 TiO_{2-x}N_x 光催化材料,该材料表现出良好的可见光敏感性,但由于其采用的前驱体-锐钛矿型 TiO₂ 已经过一次高温煅烧,再经二次高温掺 N,粉体易发生烧结,降低了 TiO_{2-x}N_x 光催化活性。Sato 等^[14]通过 NO_x 掺 N,Saha 等^[15]采用 TiN 氧化的方法也制备了 TiO_{2-x}N_x 可见光响应催化剂,但存在制备效率低、成本高等缺点。因此传统化学方法对其进行掺杂 N 效果不甚理想。Chen 等^[11,16,17]研究表明,酸催化水解法是制备高活性 N、S 掺杂可见光响应 TiO₂ 的一种有效途径。

本工作采用 TiCl₄ 酸催化水解法合成 TiO₂ 前驱体,在 NH₃/N₂ 气氛中程序升温处理,制得 N 掺杂 TiO₂ 可见光响应光催化剂。采用 DRS、XPS、XRD、FTIR、SEM 及低温氮物理吸附对其进行表征,系统研究了 N 掺杂对 TiO₂ 晶相结构、界面性质、光谱特征及可见光区、紫外光区光催化活性的影响。

1 实验部分

1.1 光催化剂制备

在冰水浴和强力搅拌的条件下,将 25 mL 的 TiCl₄ 滴加到 250 mL(5 °C)水中,以 300 r·min⁻¹ 的速度搅拌 1 h 后滴加 (NH₄)₂SO₄ 和浓 HCl 溶液反应 0.5 h,反应过程中保持 TiCl₄:(NH₄)₂SO₄:HCl 的物质的量的比为 1:2:10,然后升温至 98 °C 并保持 1 h,再以浓氨水调节 pH 值至 8,继续反应 1 h。将固相产物于室温下陈化 10 h,然后用蒸馏水洗涤,至无 Cl⁻、SO₄²⁻ 检出(滴加 0.1 mol·L⁻¹ 的 AgNO₃,无白色沉淀产生),再用乙醇洗 2 次,干燥和研磨并移入石英管式反应器。将 N₂(20 mL·min⁻¹)通入氨水中,携带 NH₃ 进入石英管式反应器,以 20 °C·min⁻¹ 的速度升至指定温度并煅烧一定的时间,尾气用酸吸收,即制得 N 掺杂 TiO₂ 光催化剂(标记为 TON-t,其中 t 为煅烧温度)。空白对照样 TiO₂ 在相同条件下,N₂ 不通过氨水直接通入石英反应器制得(标记为 TiO_{2-t},其中 t 为煅烧温度)。对照试样 P-25 催化剂为德国 Degussa 公司生产的 TiO₂(标记为 P-25)。

1.2 光催化剂活性测试

光催化反应在自制石英/玻璃夹套式反应器

(250 mL)中进行^[5],石英/玻璃管内置 8 W 低压汞灯($\lambda_{ML}=365$ nm)为紫外光光源或 350 W 球型氘灯($\lambda_{ML}=500$ nm,以玻璃滤光管滤去 $\lambda<450$ nm 的光)为可见光光源,向反应器外层夹套通入冷却水以使反应温度维持在 25±1 °C,反应器外层以铝箔包覆,以避免其他光干扰。在光催化反应开始前,避光磁力搅拌 30 min,以使 0.05 g·L⁻¹ 的苯酚水溶液在催化剂表面达到吸附平衡,并以 80 mL·min⁻¹ 速度通入空气,起搅拌和补充溶解氧作用,催化剂用量为 1.0 g·L⁻¹。每 20 min 取样 5 mL,离心分离,取上层清液以 TU-1901 型紫外-可见分光光度计于 270 nm 处测量吸光度,根据郎伯-比尔定律计算苯酚浓度。

太阳光活性测试:称 0.1 g 催化剂倒入直径为 15 cm 的平皿,加 0.05 g·L⁻¹ 的苯酚溶液 100 mL,在磁力搅拌下吸附 30 min,然后用保鲜膜封住平皿口,置于楼顶,放在阳光下照射。时间:2007 年 09 月 15 日,09:00-15:30,温度 23~33 °C。

1.3 光催化剂表征

利用美国物理电子公司生产的 PHI5700 型光电子能谱仪测试 TON 的表面组成、化学态及元素含量,X 射线源采用 Al K α ($h\nu=1486.6$ eV)射线,采用污染碳 C1s($E_a=284.6$ eV)作能量校正。利用日本理学 D/max-r B 型 X 射线衍射仪分析 TON 粉体晶型结构,测定条件为:室温 Cu K α 射线($\lambda=0.15406$ nm),靶电压 45 kV,靶电流 40 mA,扫描范围($2\theta=10^\circ$ ~ 90°),步长 0.02°。根据 Scherrer 公式计算晶粒平均尺寸。利用紫外可见漫反射光谱分析 TON 粉末的能隙结构以及对光的吸收性能,DRS 的测试在装有积分球的 TU-1901 型紫外可见分光光度计上进行,以 BaSO₄(分析纯)做参比。利用美国艾德豪克公司生产的 NICOLET380 型傅立叶变换红外光谱仪研究 TON 界面变化情况,采用 KBr 压片法。利用 QUATA200 扫描电镜观察 TON 粒子形貌与大小。利用北京彼奥德公司生产的 SSA4300 孔隙及比表面积分析仪测定 TON 催化剂比表面积,测定条件为:液氮温度(77 K)下 N₂ 吸附。

2 结果与讨论

2.1 DRS 分析

分别采用 P-25 和 TiO₂ 前驱体与 NH₃/N₂ 反应制备 TON 催化剂。结果发现,当反应温度为 400~900 °C、反应时间为 1~6 h 时,P-25 样品均为白色,DRS 分析时基本观察不到其在可见光区(≥ 380 nm)

的吸收,反应前后曲线基本重合,这说明成品TiO₂很难与NH₃/N₂反应生成TON。而采用TiO₂前驱体制备的样品均为浅黄色。

图1为不同掺N量TiO₂催化剂的DRS谱。由可以看出,水解法合成的TiO₂光吸收仅限于紫外区,掺杂N可提高TiO₂光催化剂的可见光($\lambda \geq 380$ nm)吸收性能,从而使参与光催化反应的光子数量增加。由DRS曲线的拐点可以看出,TON光催化剂的光吸收阈值发生了明显的改变。除在380 nm附近出现锐钛矿相的特征阈值外,在450~550 nm处因N的掺杂而产生第二个拐点;且随N掺杂时间的增大第二拐点光吸收阈值向长波移动量增加,这说明掺N是一个持续的过程。而第二拐点的出现表明TiO₂中出现新的能级结构。即N离子掺杂导致TiO₂晶格发生局部微变,形成一个禁带宽度较小的新能级,而新能级在 $\lambda \geq 380$ nm的光照射下就能发生电子跃迁。

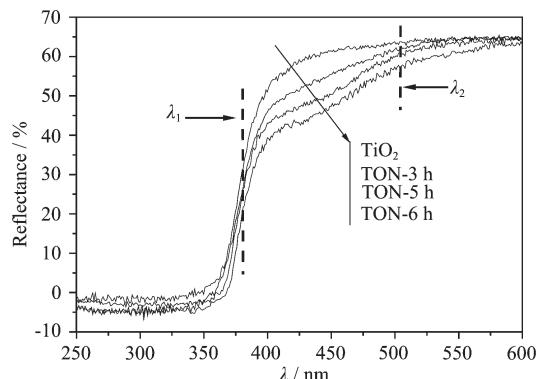


图1 不同掺N量TiO₂的DRS图

Fig.1 Effect of nitrogen doping on optical Diffuse reflectance properties of TiO₂

固定掺N时间为5 h,不同温度下制得TON的DRS结果如图2(a)。在煅烧温度≤700 °C时,TON拐点跃迁阈值以及对可见光吸收和紫外光的吸收基本一致。当煅烧温度>700 °C时,第二拐点吸收阈值向短波方向移动,对可见光的吸收减弱;第一吸收阈值开始向长波移动,但在紫外光区的吸收基本上未发生改变。在900 °C煅烧后吸收边的起始点红移至400 nm。对比不同温度下制得TiO₂的DRS图(图2b),发现TiO₂在低于600 °C煅烧时,TiO₂的漫反射光谱基本重合。高于600 °C时吸收阈值开始向长波移动。在800 °C煅烧后,TiO₂吸收边起始点红移至410 nm,这与金红石相的吸收带边界一致^[18]。由此可见N掺杂提高了TiO₂锐钛矿吸收阈值向金红相吸收阈值移动的温度。

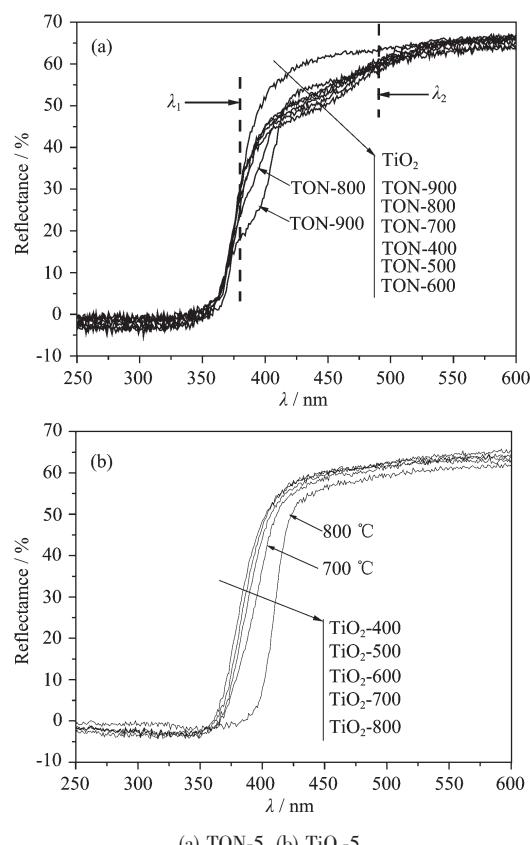


图2 不同温度煅烧制得TON和TiO₂催化剂的DRS图

Fig.2 Diffuse reflectance spectra of TON and TiO₂ catalysts prepared at different calcination temperatures

2.2 XPS分析

图3为TiO₂前驱体在500 °C下掺N 5 h所得样品的XPS谱图。图3(a)中出现了Ti₂p_{1/2}、Ti₂p_{3/2}、Ti₂s、Ti₃s、Ti₃p、O₁s、N₁s和C₁s谱峰。其中1113.3 eV和982.5 eV的谱峰分别为Ti和O的俄歇电子峰;结合图3(b),可知掺N后样品在396.8 eV出现一个新的N₁s峰,401.5 eV为催化剂表面吸附N₂的N₁s峰^[19],由此可见N原子通过化学键与TiO₂相结合。表1为不同N掺量的TON光催化剂XPS元素分析结果,从表1可以看出,各样品中Ti含量基本相同,

表1 不同N掺量的TON光催化剂XPS元素分析结果

Table 1 XPS elemental analysis results of TON with different N-doping contents

| Sample | w(Ti) / % | w(O*) / % | w(N) / % | $m(O^*) : m(Ti)$ |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| TiO ₂ | 28.35 | 71.65 | 0.00 | 2.527:1 |
| TON-3 | 28.37 | 70.82 | 0.81 | 2.496:1 |
| TON-5 | 28.35 | 70.34 | 1.31 | 2.481:1 |
| TON-6 | 28.34 | 69.98 | 1.68 | 2.469:1 |

*Oxygen in lattice.

随着N掺杂量的增加,TiO₂晶格中O含量减少,O/Ti比下降。由此表明,晶格中O被N取代,其掺杂方式是置换晶格中O^[11,15]。结合N1s XPS谱(图3(b))拟合峰,可知N是以阴离子形式进入TiO₂体相中。

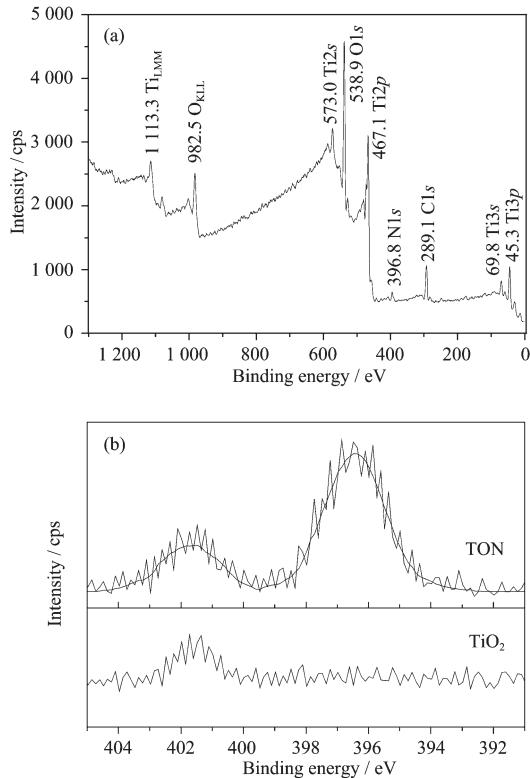


图3 TON-500 和 N1s 的 XPS 谱图

Fig.3 XPS spectras of (a) TON-500 and (b) N1s

2.3 FTIR 分析

图4为TiO₂和不同温度下制得TON光催化剂的FTIR结果。谱图中主要在3480、1600、1060和530 cm⁻¹处出现4个吸收带。其中3480和1600 cm⁻¹分别为催化剂表面O-H伸缩和弯曲振动峰,N掺杂可引起吸附水或羟基的伸缩振动特征峰变宽,可归因于掺杂N与H的相互作用^[11];530 cm⁻¹为Ti-O伸缩振动峰,N掺杂后Ti-O伸缩振动特征峰向低波数移动,同时在1060 cm⁻¹出现新的吸收峰。Liu等^[11]采用TiCl₄水解法制备的N掺杂TiO₂可见光催化剂Ti-O-N键的FTIR特征吸收峰出现在1059 cm⁻¹;TiO₂与活性炭的接触面处Ti-O-C键的FTIR特征峰出现在1020 cm⁻¹处^[20,21];Chen等^[16]采用TiCl₄酸催化水解法制备的S掺杂TiO₂宽光域响应光催化剂Ti-O-S键的FTIR特征吸收峰出现在1031 cm⁻¹;Zhang等^[22]将TiO₂/SiO₂复合催化剂Ti-O-Si键的FTIR特征峰出现在949 cm⁻¹处。N的电负性大于C、Si,因此与Ti-O-C、Ti-O-Si相比,Ti-O-N吸收峰将向长波方向移

动。即为TiO₂表面Ti-O-N特征吸收峰。由此也进一步证明了XPS结果,N掺杂后TiO₂中的部分O被取代,N原子通过化学键与TiO₂相结合。

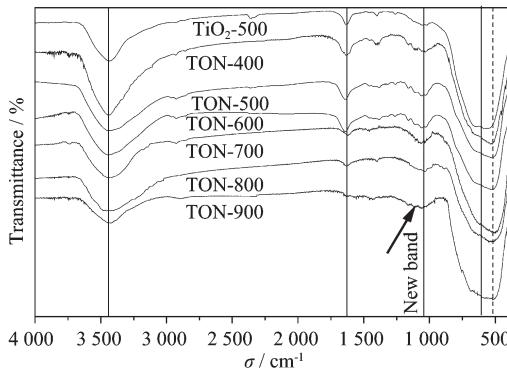


图4 TON 和 TiO₂ 光催化剂的 FTIR 图

Fig.4 FTIR spectra of TON and TiO₂ catalysts

实验合成的N掺杂TiO₂所呈现的浅黄色在催化剂于900 ℃煅烧后仍稳定存在,同时在1060 cm⁻¹出现新的吸收峰并未消失。这说明了沉积N不可能以氮氧化物的形式存在,而是N取代了TiO₂晶格中的部分氧。

2.4 XRD 分析

图5(a)、(b)为经不同温度热处理5 h制得TON和TiO₂催化剂的XRD图。由图5(a)可知,TON催化剂的XRD图上无TiN相的衍射峰出现,同时图中也未出现因N掺杂而引起的锐钛矿或金红石相TiO₂特征峰移动的现象。TiO₂前驱体为无定型结构,经400 ℃煅烧就已基本转变为锐钛矿相,在2θ=25.26°处有明显衍射峰。至500 ℃时锐钛矿晶格逐渐趋于完整,各峰对应的面间距d值与PDF211272号卡中锐钛矿型TiO₂的d值^[23]完全一致。对比图5(a)和(b),可知在低温(<600 ℃)煅烧时,N掺杂对TiO₂晶型结构影响不大。高温(>600 ℃)时N掺杂对TiO₂晶相结构影响显著。TiO₂在700 ℃开始出现金红石相,800 ℃时金红石相达93%。而TON在800 ℃煅烧才出现金红石相,且900 ℃煅烧时金红石相含量仅为61%。由此可见N掺杂对锐钛矿相TiO₂向金红石相的转变有明显抑制作用。其原因是,掺杂N进入TiO₂晶格中,提高TiO₂晶格缺陷、易导致非化学配比,从而使TiO₂相变温度升高,相变速率减慢^[24,25]。

图6为不同热处理温度下催化剂比表面积和晶粒大小的变化情况。可以看出,低温煅烧时N掺杂对于TiO₂比表面积和平均晶粒尺寸变化影响不大。当高于500 ℃煅烧时TON和TiO₂催化剂比表面积粒径均发生显著变化:粒径增大,比表面积降低。但

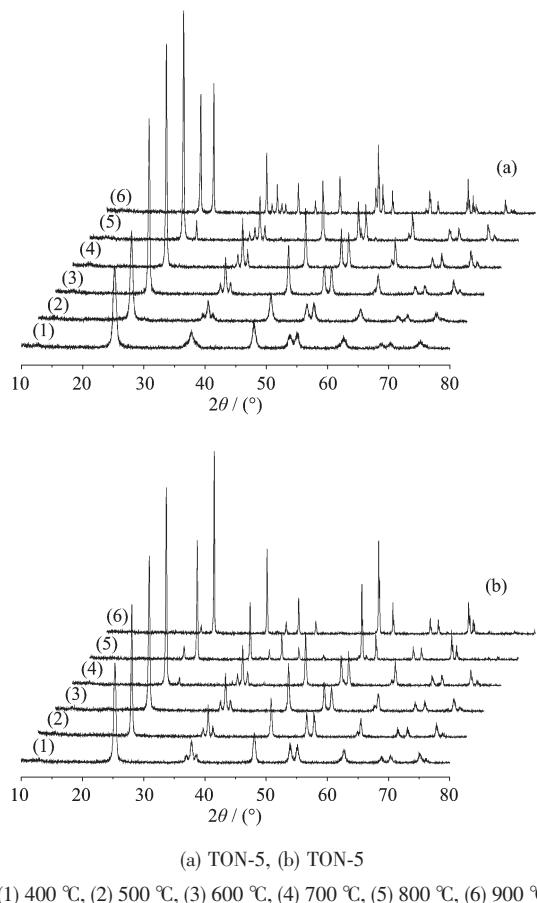


图5 不同热温度下煅烧5 h的TON和TiO₂光催化剂的XRD图

Fig.5 XRD patterns of TON and TiO₂ calcinated at different temperatures for 5 h

TiO₂粒径的增长速率和比表面积的下降速率明显快于TON。由此可见N掺杂对于抑制TiO₂晶粒增长和比表面积下降具有显著作用。另外,由于400 °C煅

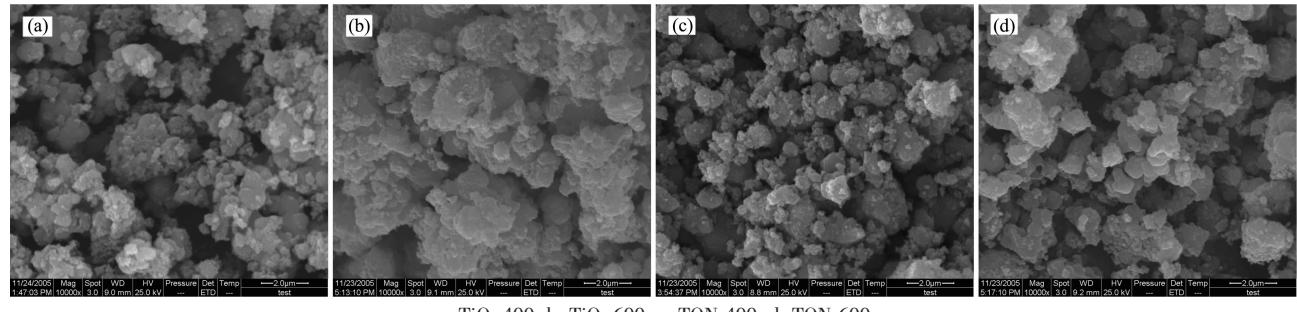


图7 不同温度下制得的TiO₂和TON光催化剂的SEM图

Fig.7 SEM images of TiO₂ and TON catalysts at different preparation temperatures

2.6 光催化剂活性

从图8a、9a催化剂的可见光活性测试结果可以看出,N掺杂后TiO₂的可见光催化活性显著提高,TON(500 °C掺氮5 h)活性最高,40 min内能实现对

烧时样品中还未形成完整锐钛矿相TiO₂晶相结构,而500 °C煅烧制得TON具有相对适宜的比表面积和晶粒大小。因此500 °C下煅烧的TON具有较高的光催化活性。

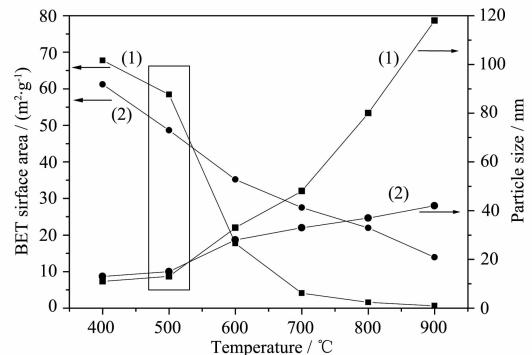


图6 热处理温度对不同光催化剂的S_{BET}和晶粒大小的影响

Fig.6 Effect of calcination temperature on BET surface area and crystal size of TiO₂ (1) and TON (2)
(calcination time: 5 h)

2.5 SEM分析

图7为不同温度下制得TON和TiO₂粒子的SEM图。由图7可知,未掺N的TiO₂分散性较差,高温煅烧后有明显团聚现象,经400 °C煅烧时其团聚体尺寸在0.4~0.5 μm左右;煅烧温度越高,其粒子团聚越明显,经600 °C煅烧时其团聚体尺寸在1.0~2.0 μm左右。对照图7a、7b可以看出,N掺杂可改善TiO₂粒子分散性、降低团聚体尺寸。对于TON粒子经400 °C煅烧时团聚体尺寸在0.30~0.4 μm之间,经600 °C煅烧时团聚体尺寸在0.4~0.8 μm之间。

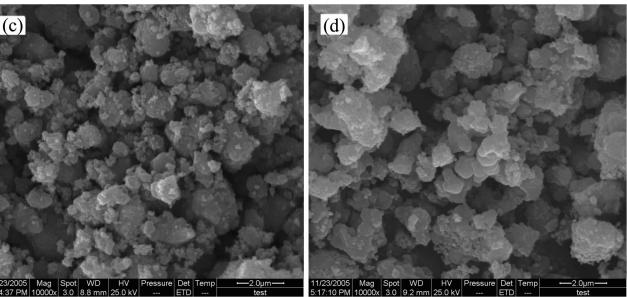


图8a、9a 催化剂的可见光活性测试结果

苯酚完全去除,而未掺杂N的TiO₂和P-25在120 min内对苯酚降解率只有21%和17%。另外,结合DRS实验可知,第二吸收阈值向长波方向移动越多,并不能保证催化剂的可见光活性越高,而是存在

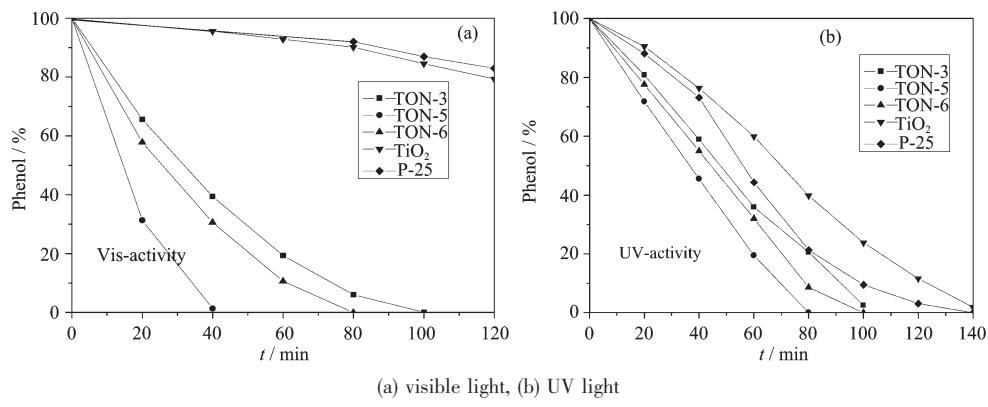
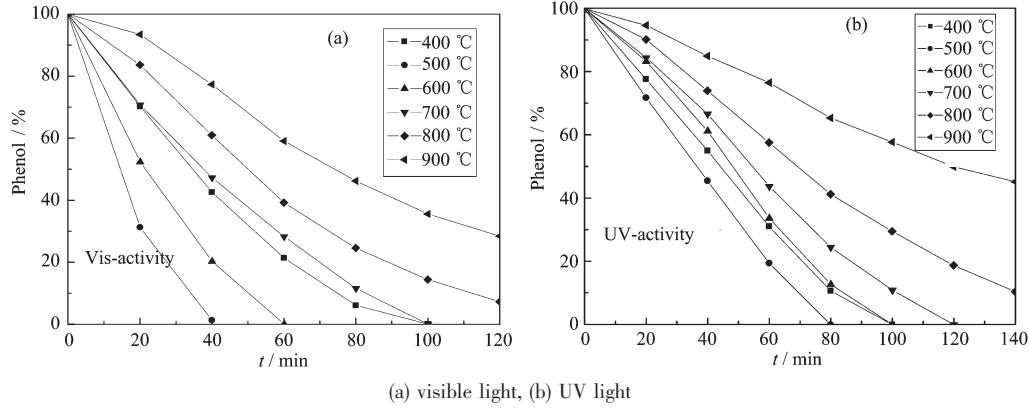
图 8 TiO₂ 及不同N掺杂量 TON 的光催化活性Fig.8 Photocatalytic activity of TiO₂ and TON with different N-doping (calcined at 500 °C)

图 9 不同煅烧温度制得 TON 光催化活性

Fig.9 Photocatalytic activity of TON calcinated at different temperatures for 5 h

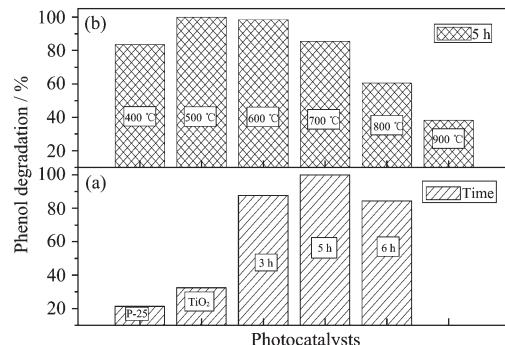
一个最佳值。图 8b、9b 催化剂紫外光活性测试结果表明,采用本方法制的 TON 催化剂不仅在可见光区保持较高活性,其紫外光区活性亦高于 P-25 和未掺 N 的 TiO₂。从图 10 太阳光实验可以看出,N 掺杂后 TiO₂ 光催化剂的活性显著提高,TON (500、600 °C 掺氮 5 h) 测试时间内能实现对苯酚完全去除,而未掺

N 的 TiO₂ 及 P-25 对苯酚的去除率都在 40% 以下。

系统比较图 8a、8b、图 9a、9b 及图 10 发现,TON 催化剂的紫外光区催化活性变化趋势与可见光区活性基本一致。由此表明,采用本方法制备 N 掺杂 TiO₂,不仅有利于拓展 TiO₂ 光响应范围,同时亦可有效提高催化剂紫外光区活性。

3 结 论

采用 TiCl₄ 酸催化水解法合成 TiO₂ 前驱体,在 NH₃/N₂ 气氛下经不同温度处理制得浅黄色的 N 掺杂 TiO₂ 可见光催化剂。研究表明,掺杂 N 以阴离子形式进入 TiO₂ 体相并置换晶格中的 O,适宜温度下制得适量 N 掺杂的 TON 在紫外光区、可见光区及太阳光下均表现出较高的活性。N 掺杂在 TiO₂ 表面生成 Ti-O-N 键,形成新的能级结构,使催化剂的吸收红移至 450~550 nm,诱发 TiO₂ 可见光催化活性。低温下煅烧,N 掺杂对 TiO₂ 的晶粒大小、比表面积和晶相结构影响不大。高温下煅烧,N 掺杂可抑制 TiO₂ 晶粒生长,减缓 TiO₂ 粒子间团聚,提高锐钛矿

图 10 太阳光下 TiO₂ 及 TON 光催化活性Fig.10 Photocatalytic activity of TiO₂ and TON under solar light (a) TON with different N-doping (calcined at 500 °C) (b) TON calcinated at different temperature (for 5 h)

相向金红石相转变温度,减缓相转化速度。

参考文献:

- [1] Yu J G, Zhou M H, Cheng B, et al. *J. Mol. Catal. A: Chem.*, **2006**,**246**(1-2):176~184
- [2] Wawrzyniak B, Morawski A W. *Appl. Catal. B: Environ.*, **2005**, **62**(1-2):150~158
- [3] Liu S X, Chen X Y, Chen X. *Chin. Chem. Lett.* **2006**,**17**(4): 529~532
- [4] Herrmann J M, Matos J, Disdier J, et al. *Catal. Today*, **1999**, **54**(2):255~265
- [5] Torimoto T, Okawa Y. *J. Photochem. Photobio. A: Chem.*, **1997**,**103**(1-2):219~227
- [6] Li D, Haneda H, Hishita S, et al. *Mater. Sci. Eng. B*: **2005**, **117**(1):67~75
- [7] SUN Xiu-Yun(孙秀云), LI Xin(李欣), DUAN Chuan-Ling(段传玲), et al. *Chinese J. Inorg. Chem(Wuji Huaxue Xuebao)*, **2007**,**23**:517~522
- [8] CHEN Ping(程萍), GU Ming-Yuan(顾明元), JIN Yan-Ping(金燕萍), et al. *Chemistry Progress (Huaxue Jinzhan)*, **2005**, **17**(1):8~14
- [9] LU Wen-Sheng(鲁文升), XIAO Guang-Shen(肖光参), LI Dan-Zhen(李旦振), et al. *Chinese J. Inorg. Chem (Wuji Huaxue Xuebao)*, **2005**,**21**:1495~1499
- [10] Ihara T, Miyoshi M, Iriyama Y, et al. *Appl. Catal. B*, **2003**, **42**(4):403~409
- [11] LIU Shou-Xin(刘守新), CHEN Xiao-Yun(陈孝云), CHEN Xi(陈曦). *Chin. J. Catal.(Cuihua Xuebao)*, **2006**,**27**(8):697~702
- [12] Ao C H, Lee S C. *J. Photochem. Photobio. A: Chem.*, **2004**, **161**(2~3):131~140
- [13] Ashia R, Ohwaki T, Ohwaki K, et al. *Science*, **2001**,**293**(5528): 269~271
- [14] Sato S. *Chem. Phys. Lett.*, **1986**,**123**(1-2):126~128
- [15] Saha N C, Tompkins H G. *J. Appl. Phys.*, **1992**,**72**(7):3072~3079
- [16] CHEN Xiao-Yun(陈孝云), LIU Shou-Xin(刘守新). *Acta Phys.-Chim. Sin.(Wuli Huaxue Xuebao)*, **2007**,**23**(5):701~708
- [17] Liu S X, Chen X Y. *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, **2007**,**82**: 453~459
- [18] ZHANG Qing-Yun(张青红), GAO Lian(高濂), GUO Jing-Kun(郭景坤). *J. Inorg. Mater. (Wuji Cailiao Xuebao)*, **2000**, **15**(5):929~935
- [19] Li Di, Ohashi N, Hishita S, et al. *J. Solid State Chem.* **2005**, **178**(11):3293~3302
- [20] CHEN Xiao-Yun(陈孝云), LIU Shou-Xin(刘守新), CHEN Xi(陈曦). *Acta Phys.-Chim. Sin.(Wuli Huaxue Xuebao)*, **2006**,**22**(5):517~522
- [21] Liu S X, Chen X Y, Chen X. *J. Hazardous Mater.*, **2007**,**143**: 257~263
- [22] Zhang X, Zhang F, Chan K Y. *Appl. Catal. A: General*, **2005**,**284**(1-2):193~198
- [23] Lu M C, Roam G D, Chen J N, et al. *J. Photochem. Photobiol. A*, **1993**,**76**(1-2):103~110
- [24] LI You-Ji(李佑稷), LI Xiao-Dong(李效东), LI Jun-Wen(李君文), et al. *J. Inorg. Mater.(Wuji Cailiao Xuebao)*, **2005**, **20**(2):291~298
- [25] CHEN Xiao-Yun(陈孝云), LIU Shou-Xin(刘守新), CHEN Xi(陈曦). *Chin. J. Appl. Chem. (Yingyong Huaxue)*, **2006**, **23**(11):1218~1222